⑫公開特許公報(A)

昭61-26768

@Int.Cl.4		識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和61年(198	86)2月6日
C 23 C G 02 B // B 32 B	14/06 5/08 9/00		7537—4K 7036—2H 2121—4F				
G 02 B	15/01 26/10	102	2121-4F 7348-2H	審査請求	未請求	発明の数 1	(全3頁)

図発明の名称 光学装置の反射鏡

②特 願 昭59-145630

②出 願 昭59(1984)7月13日

⑩発 明 者 渡 部 六 郎

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

70代 理 人 弁理士 樺 山 亨

月 条

発明の名称

光学装置の反射鏡

特許請求の範囲

アルミニウム素材に平滑面を形成し、前記平滑面に下層からニッケルクロム合金膜、銅膜および酸化硅素膜を順に形成した光学装置の反射鏡。 発明の詳細な説明

(技術分野)

この発明は、光学装置の反射鏡、特にレーザブ リンタ等に用いられるボリゴンミラーの製造技術 に関する。

(従来技術)

レーザブリンタ等に使用されるポリゴンミラーは、 水 4 図に示すような形状の回転多面鏡で、 その鏡面 S が 特度良く仕上げられていることが必要であるとともに、 高速で回転するため 高度の耐久性が受求される。 従来のポリゴンミラーは、 氷 5 図または X 6 図に示す方法は、 鏡面 S となる

面がラッピングで仕上げられた後、反射膜および 保護膜が蒸着され、分も図に示す方法は、超報密 切削により仕上げられた後、保護膜を蒸着されて、 それぞれ鏡面 8 が形成される。

ところで、従来のレーザブリンタ、レーザディ スク等に使用されるレーザは、波長が 632.8 mμ の He - Ne レーサが主流であったが、コンパクト 化および低コスト化等の要請から最近では、波長 が790 mu 付近の半導体レーザが使用されるよう になってきた。 He - Ne レーザであれば、従来の ようにアルミニウム反射面と酸化硅素保護膜とし てより十分な反射率および耐久性が得られるが、 被長が790 mμ 付近の半導体レーザを使用する場 合は、ガる図に示すように、Al 反射面では反射 塞不足を否めない。そとでこの被長 館域では Al よりも反射率の高い剱(Cu) を使用して反射面 を形成することが考えられるが、ポリゴンミラー の素材として一般に使用される Al と Cu とは密着 性が悪いので、何らかのアンダーコーティング層 が必要となる。 反射 鏡の アンダーコーティング層

としては、一般には SiO 膜が使用されているが、 この SiO 膜は Al 素材および Cu 反射膜に対する 密着性が悪いので不適当である。

(発明の目的)

この発明の目的は、したがってAl 素材上にCu 反射膜を形成する反射鏡において、Al 素材とCu 反射膜との間の密着性を高めた改良された反射鏡 を提供することにある。

(発明の構成)

この発明による反射鏡は、オ1図に示すようにA& 菜材(アルミニウム合金を含む)11上に下層から下地膜としてのニッケルクロム合金膜12、反射膜としての網膜13、保護膜としての酸化硅素膜14 を順に形成して構成される。

以下、この発明による反射網の製造方法の一例を、ポリゴンミラーを例にとって説明する。まずアルミニウム素材11の外間を切削してオ4図に示すような形状の多面体を形成し、その鏡面Sとなる面をダイヤモンド工具で平滑に仕上げる。この多面体をきれいに洗浄した後、真空蒸着装置内に

この発明において、銅膜13の代りにアルミニウム膜を形成すれば、従来と同様な反射鏡を作製することができる。また真空蒸着法の代りにスパッタリング法やイオンブレーディング法を膜形成のために使用することができる。さらにポリゴンミラーだけでなく、他のレーザ応用機器、計測機器、医療用機器、複写機等の光学装置の反射鏡にも応用することができる。

(発明の効果)

以上のように、この発明による反射鏡は、アルミニウム器材上に下から下地膜としてのニッケルクロム合金膜、反射膜としての銅膜、保護膜としての酸化硅素膜とを順に形成してあるので、長波及城での反射率が高く、しかも下地膜としてニッケルクロム合金膜を使用しているので、アルミニウム器材と銅膜に対する密着性が良く、耐久性の高い反射鏡を得ることができる。

図面の簡単な説明

オ1図は、この発明による反射鏡の部分断面図、 オ2図は、この発明における酸化硅聚膜の光学的

取り付け、まずペルジャー内を真空度約5× 10⁻⁵ Torr まで排気した後、アルゴンガスを導入 して約1×10⁻⁵ Torr で5分間イオンボンパード を施し、次に 5 × 10⁻⁵ Torr 以下まで排気して、 タングステンポートに入れたニッケルクロム合金 を速度 10 ~ 15 Å / sec で膜厚 150 ~ 250 Å に蒸 着する。次いで、真空度2× 10 ⁻⁵ Torr 以下でセ ラミックポートに入れた銅を速度 25 ~ 40 Å/ sec で膜 厚 500 ~ 750 Å に蒸着する。最後に、真 空度 9 × 10⁻⁵ Torr 以下でタンタルるつぼに入れ た酸化硅素を速度2~3 Å/ sec で膜厚 2300 ~ 2600 A に蒸着する。酸化硅素膜の厚さは、オ2 図に示すように、その屈折率をn、幾何学的膜厚 を d、基準波長を λο とすると、その光学的膜厚 nd d, $nd = \lambda_0 / 4 \kappa \kappa_0 \delta \delta$, $\lambda_0 / 2 \delta \delta$ に最も反射率が高くなるので、そのように定める。 ごのようにして作製されたポリゴンミラーは、 波長 790 mμ の赤外域で反射率 95 % 以上を有し、

膜厚と反射率との関係を示す図、オ3図は、アルミニウム膜と網膜とにおける波長と反射率との関係を示す図、オ4図は、ボリゴンミラーの斜視図、オ5図およびオ6図は、従来のポリゴンミラーの製造工程を示す図である。

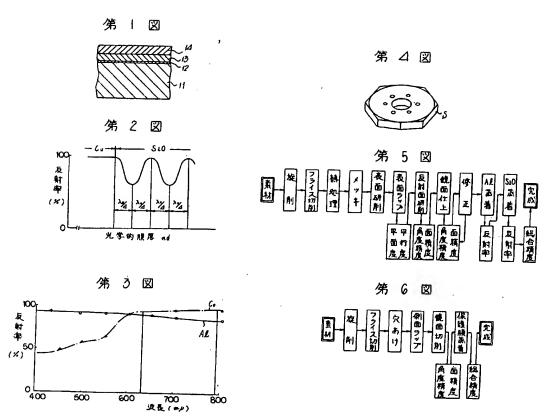
またモータに取り付けて 6000 rpm で回転させて

も、その鏡面には何らの異常も認められなかった。

11…アルミニウム累材、12…ニッケルクロム合 金膜、13… 銅膜、14… 酸化硅累膜、8 …鏡面

代 選 人 「 樺 山





DERWENT-ACC-NO: 1986-078331

DERWENT-WEEK:

198612

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Polygon mirror for laser printer -

includes aluminium

layer over nickel-chromium alloy, and

silicon oxide films

----- KWIC -----

Basic Abstract Text - ABTX (1):

A smooth surface is formed on Al raw material and is formed with a Ni-Cr alloy film, Cu film and silicon oxide film.

Basic Abstract Text - ABTX (2):

The film thickness may be 150-250 angstroms for Ni-Cr, 500-750 angstroms for

Cu and 2300-2600 angstroms for SiO with its optical film thickness nd = 1 0/2,

n being refraction index, d geromatrix film and 1/0 standard wavelength. For a

semiconductor laser beam of wavelength about 790 microns, an Al reflecting

mirror is insufficient in reflection index (%). higher reflection index

Cu is attached to Al within the range of wavelength, Cu is of bad coherence to Al.

Basic Abstract Text - ABTX (3):

ADVANTAGE - The Ni-Cr alloy improves coherence of Cu to Al. The SiO film serves as a protector for the mirror.

Title - TIX (1):

Polygon mirror for laser printer - includes aluminium layer over

05/16/2003, EAST Version: 1.03.0002